

Specyfikacja zamówienia podłoży do wzrostu nanostruktur na systemie MBE – Riber Compact21

I. Podłoża CdZnTe [100]

Rozmiary:

10mm x 10 mm - szt. 50

20 mm x 20 mm – szt. 10

Orientacja: (100)

Obróbka powierzchni: polerowana o najwyższej jakości

II. Podłoża GaAs

Rozmiary:

2" – szt 60

3" – szt 10

Orientacja: (100)

Obróbka powierzchni: polerowana o najwyższej jakości

III. Podłoża InP

Rozmiary:

2" – szt. 20

3" – szt. 10

Orientacja: (100)

Obróbka powierzchni: polerowana o najwyższej jakości

Kontakt:

Grendysa Jakub, e-mail: grendysa@univ.rzeszow.pl